

名前：_____

【重要】Adobe Readerで入力してください。
Macユーザーの方は、「プレビュー」を使用しないでください。

2026 年度国内若手クリエイター滞在プログラム アプリケーションフォーム

1) 名前

氏名:
アーティスト名:

2) 語学

英 語	ネイティブレベル	上級レベル	中級レベル	初級レベル
-----	----------	-------	-------	-------

3) 学歴（教育機関名、学部、専攻など）

入学年月	卒業・修了年月	最新のものから順に3つまでご記入ください

4) 職歴（所属機関、役職）

開始年月	終了年月	最新のものから順に3つまでご記入ください

5) アーティスト・イン・レジデンス歴（施設名、都市・国、助成金受給の有・無など）

開始年月	終了年月	（最新のものから順に3つまでご記入ください）

名前：_____

6) 活動歴

年	月	主要な展覧会・プロジェクト歴：最新のものから順にご記入ください
例：2023	11-12	「Chroma11」グループ展、トーキョーアーツアンドスペース本郷、東京

7) 受賞・助成金受給歴（賞名、助成金（奨学金）名、授与者、助成者、受賞作品名など）

年	月	（最新のものから順に3つまでご記入ください）

名前： _____

8) 制作コンセプトと滞在目的、活動計画

1. ご自身の作品、制作手法、リサーチ対象について、2つ～4つのキーワードを挙げてください。

•	•
•	•

2. ご自身の作品、制作コンセプトについて、過去または現在進行中のプロジェクトと関連させて述べてください。(250字以内)

3. ご自身の活動やプロジェクトの実践のために TOKAS、または東京で滞在を希望する理由を述べてください。TOKAS またはレジデンス・プログラムに期待することがあれば教えてください。(250文字以内)

4. プロジェクトプランやリサーチプランについて触れながら、レジデンスの目的や滞在中の過ごし方について述べてください。(300文字以内)

5. コンタクトを取りたい機関や関係者がいれば、名前を挙げてください。既にコンタクト済みの場合はその旨を明記してください。